

溶胶-凝胶法制备高取向K(Ta,Nb)O₃薄膜

包定华* 王世敏 顾豪爽 赵剑洪 黄桂玉 邝安祥

(湖北大学物理系, 武汉 430062)

关键词: 溶胶-凝胶法 K(Ta, Nb)O₃ 高取向薄膜

K(Ta, Nb)O₃ 具有良好的电光特性、非线性光学特性和热释电特性。K(Ta, Nb)O₃ 薄膜在光电子集成电路中有着良好的应用前景^[1]。国外主要是进行 K(Ta, Nb)O₃ 单晶和陶瓷的研究工作, 近年来也有制备 K(Ta, Nb)O₃ 薄膜的报导^[2,3]。我们采用溶胶-凝胶法制备 KTa_{0.65}Nb_{0.35}O₃ 薄膜。

制备过程如下: 把 Ta(OC₂H₅)₅, Nb(OC₂H₅)₅ 和 K(OC₂H₅)₃ 溶于无水 C₂H₅OH 中配成 0.2 mol·L⁻¹ 的均匀溶液, 以 SrTiO₃(100) 单晶为衬底, 通过浸渍提拉(dip-coating) 法制备薄膜, 提拉速率为 1 cm·s⁻¹, 制得的湿膜通过空气干燥形成凝胶膜, 然后进行热处理, 在 400°C 预烧保温 0.5 h 至 700°C 保温 1 h 后退火。

图 1 是 Sol-Gel 法制备的 KTa_{0.65}Nb_{0.35}O₃ 薄膜和粉末的 X 射线衍射图, 薄膜厚度约为 0.25 μm。从图 1 可以看出, K(Ta, Nb)O₃ 粉末属立方相结构, K(Ta, Nb)O₃ 薄膜仅有 (100), (110), (200), (300) 峰, 峰的位置与粉末峰的位置存在着很好的一一对应关系, 且 (110) 峰的强度很小, 因此, K(Ta, Nb)O₃ 薄膜是沿 (100) 取向生长的, 取向率为 93%。根据薄膜外延生长的一般规律, 要求衬底和薄膜材料的晶格常数互相匹配、热膨胀系数相近。KTa_{0.65}Nb_{0.35}O₃ 的晶格常数为 3.990 Å, SrTiO₃(100) 单晶的晶格常数为 3.905 Å, 两者的失配率为 2.1%, 如此小的失配可使薄膜通过晶格常数的畸变达到与衬底之间的匹配。另外, K(Ta, Nb)O₃ 与 SrTiO₃ 单晶具有相同数量级的热膨胀系数, 这两个因素对获得取向薄膜有利, 如仔细

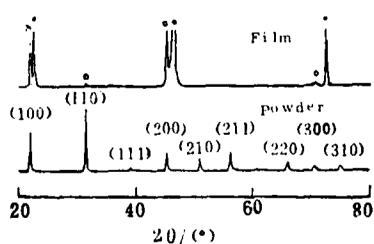


图 1 Sol-Gel 制备的 KTN 薄膜和粉末的 XRD 图
Fig.1 The XRD patterns of KTN thin film
and powder prepared by Sol-Gel process
• KTN, • SrTiO₃

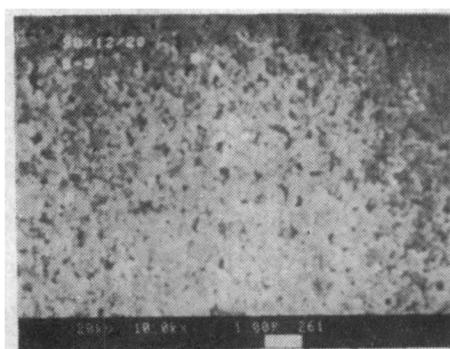


图 2 K(Ta, Nb)O₃ 薄膜的 SEM 图
Fig.2 The SEM micrograph of
K(Ta, Nb)O₃ thin film

控制工艺参数，可望实现 $K(Ta, Nb)O_3$ 薄膜的外延生长。

图 2 是 $K(Ta, Nb)O_3$ 薄膜的扫描电镜图，薄膜的工艺参数同图 1，可以看出，薄膜表面均匀，无裂纹，致密。

采用电感耦合等离子光谱法 (ICPS) 测定薄膜的成分，得到薄膜中 K, Nb, Ta 元素的相对重量，换算成原子比为 $K:Ta:Nb = 1.000:0.655:0.355$ ，表明用 Sol-Gel 工艺制备的 $K(Ta, Nb)O_3$ 薄膜有准确的化学计量比。

有关 $K(Ta, Nb)O_3$ 薄膜的电光性能正在研究之中。

参 考 文 献

- 1 Scheel H J, Gunter P. in Crystal Growth of Electronic Materials (Ed, Kallis, E.) , Elsevier, Amsterdam, 1985. 149
- 2 Hulliger J, et al. *Thin Solid Films*, 1989, 175:201
- 3 Condensed Matter News, 1992, 1(5):8

HIGHLY-ORIENTED $K(Ta, Nb)O_3$ THIN FILM DERIVED BY SOL-GEL PROCESS

Bao Dinghua* Wang Shimin Gu Haoshuang Zhao Jianhong

Huang Guiyu Kuang Anxiang

(Department of Physics, Hubei University, Wuhan 430062)

ABSTRACT

Highly-oriented $K(Ta, Nb)O_3$ thin film is prepared by Sol-Gel process, using $K(OC_2H_5)_5$, $Nb(OC_2H_5)_5$ and $Ta(OC_2H_5)_5$ as raw materials. The surface of thin film is smooth, homogeneous, crack-free and dense.

Keywords: Sol-Gel process, $K(Ta, Nb)O_3$, Oriented thin film